

等离子体增强蒸发沉积 Pecvd 涂层机

货号: KT-PED



简介

使用 PECVD 涂层设备升级您的涂层工艺。是 LED、功率半导体、MEMS 等领域的理想之选。在低温下沉积高质量的固体薄膜。

[了解更多](#)

样品支架	尺寸	1-6 英寸
	旋转速度	0-20rpm 可调
	加热温度	≤800°C
	控制精度	±0.5°C 岛电 PID 控制器
气体吹扫	流量计	质量流量计控制器 (MFC)
	通道数	4 个通道
	冷却方式	循环水冷却
真空室	真空室尺寸	Φ500mm X 550mm
	观察孔	带挡板的全视角观察孔
	腔体材料	316 不锈钢
	门类型	前开式门
	盖子材料	304 不锈钢
	真空泵接口	CF200 法兰
	气体入口	φ6 VCR 连接器
等离子电源	电源	直流电源或射频电源
	耦合模式	电感耦合或板电容
	输出功率	500W-1000W
	偏置功率	500v
真空泵	前级泵	15L/S 片式真空泵
	涡轮泵端口	cf150/cf200 620升/秒-1600升/秒
	溢流口	KF25
	泵速	叶片泵：15升/秒，涡轮泵：1200升/秒或1600升/秒
	真空度	≤5×10 ⁻⁵ Pa
	真空传感器	电离/电阻真空计/薄膜真空计

系统	电源	交流 220V /380 50Hz
	额定功率	5kW
	外形尺寸	900 毫米 X 820 毫米 X 870 毫米
	重量	200 千克